

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成21年11月12日(2009.11.12)

【公表番号】特表2007-529461(P2007-529461A)

【公表日】平成19年10月25日(2007.10.25)

【年通号数】公開・登録公報2007-041

【出願番号】特願2007-503290(P2007-503290)

【国際特許分類】

C 07 C 67/48 (2006.01)

B 01 D 53/14 (2006.01)

C 07 C 69/82 (2006.01)

【F I】

C 07 C	67/48	
B 01 D	53/14	1 0 2
C 07 C	69/82	A

【誤訳訂正書】

【提出日】平成21年9月15日(2009.9.15)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

芳香族ジカルボン酸のジアルキルエステルA)を含有しているガス流を精製及び冷却する方法であつて、

第一段階において脂肪族ジヒドロキシ化合物B)でガス流を、ジアルキルエステルA)の融点よりも低い/同じ温度で処理し、少なくとも1つの第二段階において脂肪族ジヒドロキシ化合物B)でガス流を、ジヒドロキシ化合物B)の融点を上回って処理し、並びに前記第一段階においてジヒドロキシ化合物B)が140よりも低い/同じ温度を有し、かつ前記第二段階において20~80の温度を有することを特徴とする、芳香族ジカルボン酸のジアルキルエステルA)を含有しているガス流を精製及び冷却する方法。

【請求項2】

ジアルキルエステルA)としてテレフタル酸、イソフタル酸、2,6-ナフタレンジカルボン酸又はそれらの混合物のエステルを使用する、請求項1記載の方法。

【請求項3】

炭素原子1~4個を有するアルキル基を有するジアルキルエステルA)を使用する、請求項1又は2記載の方法。

【請求項4】

ガス流として、負荷された不活性ガス流を精製及び冷却する、請求項1から3までのいずれか1項記載の方法。

【請求項5】

ジヒドロキシ化合物B)として炭素原子2~6個を有するジオールを使用する、請求項1から4までのいずれか1項記載の方法。

【請求項6】

ジヒドロキシ化合物B)として1,4-ブタンジオールを使用する、請求項1から5までのいずれか1項記載の方法。

【請求項7】

ジアルキルエステルA)としてテレフタル酸ジメチルを使用する、請求項1から6までのいずれか1項記載の方法。

【請求項8】

ジアルキルエステルに対するガス流の飽和度[%]が50%よりも少ない/同じである、請求項1から7までのいずれか1項記載の方法。

【請求項9】

精製及び冷却後にガス流が20質量ppm未満の芳香族ジアルキルエステルA)を含有する、請求項1から8までのいずれか1項記載の方法。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0018

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0018】

故に、本発明の課題は、芳香族ジカルボン酸のジアルキルエステルA)を含有しているガス流を冷却及び精製するための改善された方法を提供することであって、第一段階において脂肪族ジヒドロキシ化合物B)でガス流を、ジアルキルエステルA)の融点よりも低い/同じ温度で処理し、かつ少なくとも1つの第二段階において、脂肪族ジヒドロキシ化合物B)でガス流を_ジヒドロキシ化合物B)の融点を上回って処理することにより特徴付けられている。